# 解説

# PFリングにおける光軸安定化の現状

## 中村 典雄

高エネルギー物理学研究所放射光実験施設

# Present Status of Beam Position Stabilization at Photon Factory Storage Ring

#### Norio Nakamura

Photon Factory, National Laboratory for High Energy Physics

Stabilization of photon beam position became a major issue in the operation of the storage rings dedicated as synchrotron radiation source. At the Photon Factory storage ring(PF ring), the orbit movement appeared remarkably when the low-emittance operation started. This orbit movement became a serious problem to synchrotron radiation users because the photon beam to drift with a large amplitude. The horizontal and vertical orbit feedback systems were constructed and developed in order to suppress the orbit movement globally. As a result, the horizontal and vertical orbit movements were reduced by a factor of five and ten, respectively. In addition, another type of feedback system using a local bump was constructed. In the test operation, this system could remove the fast photon beam motion as well as the slow photon beam drift for a beamline.

### 1. はじめに

近年,放射光リングにおいて光軸の安定化は1 つの重要なテーマになってきた。放射光実験施設 (PF)でも放射光ビームの変動を抑えることが3 年前のリングの低エミッタンス化以来不可欠なも のになっている。ここでは,光軸を不安定にする ビーム変動とそれを抑え込むための光軸安定化シ ステムの現状について述べることにする。PFリ ングでは1988年7月より電子に代わり陽電子によ る運転を行っているが,本稿に関する限り両者に 本質的な差はないので電子という言葉を統一的に 使用することにする。

### 2. ビーム変動

PFリングでは1987年2月に、放射光ビームの輝 度を上げるために電子ビームの低エミッタンス化 が行われた<sup>1)</sup>。この低エミッタンス化によって水 平方向のエミッタンスは400nmradから130nmrad になり、各ビームラインでの放射光ビームの輝度 は以前と比較して2~20倍に高まった。しかし、 一方で電子ビームは外乱に対して敏感に反応する ようになり、種々のビーム変動が顕著に現れ始め



Fig. 1 Main ring components(bending and quadrupole magnets,kicker and septum magnets, insertion devices and RF cavities) .

た。これは、低エミッタンス化を行うために四極 電磁石の磁場を強くしたことに依る。現在のPF リング(図1)で観測されているビーム変動につ いて以下に述べる。

#### 2.1 日較差変動

種々のビーム変動の中で低エミッタンス化後に 最も放射光ユーザーにとって深刻な問題となった のが日較差変動である<sup>2),3)</sup>。低エミッタンス化 前後に観測されたBL-21での垂直方向の放射光 光軸の動き(光源点から10m地点)を図2に示 す。低エミッタンス後において光軸変動の振幅は 4~5倍に膨れ上がっていることがわかる。図か らわかるように、この変動はほぼ1日を周期とし ていて正弦関数に似た動きをする。このような変 動は他のビームラインでも観測され、ビームライ ンや光源点からの距離に依存して垂直方向では1 ~5mmの振幅を持っている。また、外気温や天候 に依存してその振幅を変えるという性質がある。 例えば,晴れの日は振幅が大きく,雨や曇りの日 は振幅が小さくなる。

日較差変動の原因はリングを覆っている建物が 日射や外気との熱のやりとりによって僅かに変形 するためであることがわかっている<sup>3),4),5),6)</sup>。 この建物の熱変形はリングの変形を生み,電子 ビームの軌道を変化させる。図3に1日における 水平および垂直方向の電子軌道の変化を示す。そ の変化量は気象条件に依存して変わるが,その形 は各方向でほぼ一定している。水平成分はおもに リングの伸縮によって,垂直成分はリングの床が 動いて電磁石列が乱れることによってその形を説 明することができる。光軸の日較差変動はこの電 子軌道の日較差変動に起因している。一般に光源 点から距離Lだけ離れた光軸の位置変化( $\Delta$ Yp) は、光源点での電子ビームの位置及び角度の変化 ( $\Delta$ Y, $\Delta$ Y')を使って次のように表せる。









115

- 5 -

$$\Delta \mathbf{Y} \mathbf{p} = \Delta \mathbf{Y} + \Delta \mathbf{Y}' \cdot \mathbf{L} \tag{1}$$

これから光軸の変動量が各光源点でのビームの 動きと光源点からの距離に依存することがわか る。

#### 2.2 その他の変動成分

日較差変動以外にも種々のビーム変動が存在す る。その変動量は日較差変動と比べると小さい が、ユーザー実験によっては問題となる可能性が ある。まず、現在PFリングに6台置かれている 挿入光源の磁場の設定変更に伴う軌道の変化があ る。挿入光源自身、軌道補正のための電磁場を 持っているが、軌道のパラメータが運転期間毎に 微妙に変わるために完全に変動を抑えるには至っ ていない。従って、磁場の設定変更は現在のとこ ろビーム入射の時に行われている。図4にBL-4 で観測された垂直方向の光軸変動を示す。図中の 6分周期のビームの動きは僅かなリング電磁石用 冷却水の温度変化(~1℃) と強く相関してい る。また、同じ研究所内のTRISTANリング電 磁石の電子・陽電子ビーム加減速に伴う磁場の変 化は、PFリングの電子ビーム軌道に影響を与え る。その結果、階段状の位置変化が光軸に起こっ ている。さらに時間のスケールの小さな変動はど うなっているであろうか。図5に, BL-21の放射

光ビーム位置モニターの出力をFFTアナライ ザーで周波数分解した例を示す。AC電源による 50Hz成分の他に、いくつかのピークがあること がわかる。これはリングトンネル用の空気冷却機 や超伝導ウィグラー用の液体へリウム冷凍機等の 振動が電磁石に伝わって電子ビームを揺らすため である<sup>7)</sup>。このような短周期変動は外国の放射光 リングにも同様に現れている<sup>8)、9)、10)</sup>。

# 3. 垂直方向の軌道フィードバック・ システム<sup>2),3)</sup>

ここでは、垂直方向の日較差変動をリング全周 にわたって抑え込むためのフィードバック・システ ムについて述べる。このシステムは計算機によっ て制御されているので、"デジタル"・フィード バック(DBF:digital feedback)とも呼ばれる。

#### 3.1 システムの構成

図6にシステムの構成を示す。システムは大き く4つの装置に分けられる。それらは、電子ビー ムの軌道を測定する電子ビーム位置モニター (PM:position monitor),電子ビームの軌道を補 正する補正用電磁石(CVS, FVS),光軸の位置を ビームライン上で検出する放射光ビーム位置モニ ター,それにこれらを制御する制御計算機システ ムである。以下に各装置の説明を簡単に述べる。











Fig. 6 Vertical orbit feedback system.

- 7 -

・電子ビーム位置モニター(PM)<sup>11),12),13)</sup>

電子ビーム位置モニターは真空チェンバーに取 り付けられた6つのボタン型電極から成ってい る。上下の2つの電極は通過する電子ビームの垂 直方向の位置を,残りの左右4つの電極は水平方 向の位置を求めるために使われる。このモニター は水平・垂直両方向の電子軌道の測定をするため にリング全周で45個配置されている。全部で45X 6=270の電極信号を扱うための信号処理システム が設けられ、マルチプレクサー(MPX:multiple xer), 増幅器 (AMP: amplifier), ADC等で構成さ れている。最終的に電極信号は計算機(HP310) に送られ、電子ビーム位置に変換される。この1 回の軌道測定に費やされる時間は約40秒である。 電子ビーム位置モニターの相対的な位置精度は10 *μ*m程度であるが、マルチプレクサーの1つであ る同軸スイッチの劣化によって100μm以上に落 ちることがときどき起きる。

#### ・ 補正電磁石(FVS, CVS)

垂直方向の軌道を補正する電磁石にはCVSとF VSの2つの種類がある。CVS(coarse vertical steering magnet)は低エミッタンス化前から軌 道補正用に備え付けられていた42台の電磁石であ b, FVS(fine vertical steering magnet) t フィードバック用に新たに設けられた20台の電磁 石である。FVSは芯が積層硅素鋼板でできてい てコイルの巻数もCVSに比べて小さいために、 磁場設定に対して速い応答性を有している。ま た, FVSの電源は16ビットのDACによって細か い磁場設定が可能になっている。従って, FVSは フィードバックのような速く細かい軌道補正に向 いている。ただし、あまり高い磁場を出すことが できないので、リング立ち上げ時の大きな軌道補 正にはCVSが使われている。図6に示すよう に、各々の電源(PS:power supply)はCU-85や VMEといったコントローラを介して計算機から 制御されている。

・放射光ビーム位置モニター<sup>14),15),16)</sup>

放射光ビーム位置モニターは現在ビームライン BL-4, BL-7, BL-10, BL-12, BL-21に設置さ れて、光軸の動きを監視している。特にBL-21 ではリング運転中常時シャッターが開けられてい て、そこのモニターからの位置データは計算機に 送られている。放射光位置モニターはその構造上 3種類に分かれ、各々two-wire photoemission monitor(WM), split ion chamber(SIC), split photoemission chamber(SEC)と呼ばれてい る。いずれも~1  $\mu$ m程度の位置分解能を有して いる。各種類のモニターについての詳細は参考文 献を参照していただくとしてここでは割愛する。

### ・<u>制御計算機システム</u>

制御計算機システムは基本的にはCVS, FVS, 電子ビーム位置モニターをそれぞれ制御する3つ の計算機(S3500, HP310, HP310)から成る。 S3500ミニコンピュータはCVSの他に偏向電磁 石や四極電磁石などリング及びトランスポート・ ラインの電磁石全般の制御を行っている。2つの HP310マイクロコンピュータはフィードバック 用に新たに加えられたものである。これらの計算 機はサーバ(server)でつながれていて,データの 通信や保存を容易に行うことができる。また,他 のHP計算機(HP330, HP370)からも容易にデー タを利用することができる。HP310で得られた 軌道データは大型計算機(M780)のデータベース (database)にも保存されて,大量なデータ処理 や複雑な解析等に使われている。

#### 3.2 フィードバック方式とその評価

PFリングでは固定パターン方式と変動パター ン方式と呼ばれる2つの種類のフィードバック方 式がある。これまで通常の運転では固定パターン 方式が使用されてきたが、変動パターン方式が 1989年11月から実用化されている。

#### (a) 固定パターン方式

軌道の変化を補正するために20台の補正電磁石 に流すコイル電流のパターンを固定している。す なわち,垂直方向の日較差変動による電子軌道の 変化の形が一定であると仮定している。実際には 次のような手続きに従って行われる。

- 日較差変動による電子軌道の歪みの形を電 子ビーム位置モニターで測定する。
- ② 測定された軌道の歪みを補正するために必要な電流値を20台の補正電磁石(FVS)について計算する。
- ③ 計算された電流値を細分割して, BL-21の 放射光ビーム位置モニターで5 µmの変位に 対応する補正電流ユニットを作る。
- ④ 42台の補正電磁石(CVS)で運転開始時に 初期の電子軌道を設定し、同時にBL-21で の光軸の初期位置を決める。
- ⑤ BL-21での位置が初期値から5µmずれる 度に、補正電流ユニットを補正電磁石(FVS) の現在の電流値に加えて日較差変動を補正す る。

①~④の手続きは予めリング運転前に行われ る。従って通常,運転中は⑤のみが計算機を通し て繰り返し実行される。BL-21でビーム位置を 読んで補正電磁石によって電子軌道を補正するの に費やされる時間は2秒で,日較差変動に比べて 十分に速いものになっている。図7にフィード バック停止中,図8に固定パターン方式による フィードバック作動中の1日の軌道の変化を示 す。フィードバックによってリング全周にわたっ て軌道の変化が良く抑えられていることがわか



Fig. 7 Vertical orbit movement in a day without the vertical orbit feedback.

る。固定パターン方式によるフィードバック作動 中の1日の軌道の変位は日によって(気象条件に よって)異なるが,各電子ビーム位置モニターの 位置で平均して~100µmである。これはフィー ドバック停止中の軌道変位の約1/5である。ただ し,日較差変動は完全に一定の軌道変化ではない ので,日に依っては軌道変化の抑え残しが大きく 出る。また,日較差変動以外の軌道変化に対応で きないという欠点がある。

(b) 変動パターン方式

変動パターン方式では固定パターン方式と異な り電磁石への電流パターンは常に変化する。具体 的な手順を以下に示す。

- 固定パターン方式同様,運転開始時にCVS を使って初期軌道すなわち基準軌道を設定す る。
- ② 電子軌道を一定時間間隔(10分)で測定し、測定の度にデータをサーバ上のディスクに格納すると共に測定終了のフラッグをディスクに立てる。
- ③ 補正電磁石(FVS)を制御する計算機が測定終了のフラッグを確認し、測定された軌道 データをサーバから読み込み基準軌道からの ずれを求める。
- ④ さらに計算機が基準軌道からのずれを補正 する電流パターンを計算し、そのパターンを 数百ステップに分けて現在のコイル電流値に 加える(1回の補正を数百ステップに分ける



Fig. 8 Vertical orbit movement in a day without the vertical orbit feedback.

- 9 -

のは、補正による位置の変化を時間的にゆる やかにするためである)。

この方式は固定パターン方式と異なり日較差変 動による軌道の変化のパターンが日々変化しても それに対応することができる。加えて、日較差変 動以外の軌道変化にも対応できるという利点があ る。図9に示すように、変動パターン方式での軌 道変化の抑え残しは固定パターン方式の時と比較 して半分以下に減少している。この方式における 今後の課題は、電子軌道の測定間隔を縮めていく ことにある。それによって日較差変動の抑え残し も小さくなるし、もっと速い変動成分にもフィー ドバックが追随できることになるからである。し かし、現在のシステムでは時間間隔をこれ以上短 くしても電子ビーム位置モニターによるビーム位 置測定の誤差がビームの変動量よりも大きくなっ てしまう。また、測定回数の増加は同軸スイッチ の劣化を速めることにもつながる。従って、この 方式をさらに発展させるには電子ビーム位置モニ ター系の改良が必要となってくるであろう。

# 4. 水平方向の軌道フィードバック・ システム<sup>17)</sup>

日較差変動の水平方向の成分は、2章で述べた ように主にリングの伸縮によって生じている。リ ングが伸縮するとビーム位置は相対的に変化し、 特に分散関数(dispersion function)の大きいと ころで変化が顕著になる。従って、その変化は図





Fig. 9 Residual vertical orbit displacements in (a) fixed pattern and (b) variable pattern methods: differences of orbits measured at 16 : 00 and 6 : 00.

3にみられるように分散関数の形を反映してい る。この軌道変化を補正するために, RF周波数 を変更して電子ビームの軌道長をリングの伸縮に 追随させるシステムが必要である。それがここで 述べるフィードバック・システムである。図10に このシステムの構成及びフィードバックの流れを 示す。このシステムでも電子ビーム位置モニター が水平方向の電子軌道を測定するために使われて いる。定間隔(10分)で測定されたビーム位置を 用いてリングの伸び(あるいは縮み)ΔCを次式 に基づいて計算する。

$$\frac{\Delta C}{C} = -\alpha \frac{\sum \Delta \mathbf{x}_i \eta_i}{\sum \eta_i^2} \quad (i = 1, \dots, 45) \quad (2)$$

ここで $\Delta x_i$ ,  $\eta_i$ はそれぞれ水平方向の電子ビーム の位置変化とそこでの分散関数の値である。また, Cはリングの周長で $\alpha$  はmomentum compaction factorである。これから加えられるべきRF周波 数の増分 $\Delta f_{RF}$ は次のようになる。

$$\Delta \mathbf{f}_{RF} = -\mathbf{f}_{RF} - \frac{\Delta \mathbf{C}}{\mathbf{C}}$$

RF周波数の変更は軌道測定用計算機からRFシ ステムに伝えられ実行される。図11にフィード バック作動中とフィードバック停止中の1日の軌 道の変位を示す。水平方向の変動はフィードバッ クによって約1/5に減っていることがわかる。

 ワーカルバンプを用いたフィード バック・システム<sup>2),8),18),19),20),21)</sup> これまでに述べられてきたフィードバックは、







(3)

Fig.11 Horizontal orbit displacements with and without the horizontal orbit feedback.

比較的ゆっくりとしたビーム変動(日較差変動) をリング全周にわたって抑えるものであった。こ こでは、もっと速い成分を含んだビーム変動を局 所的に(例えば1つのビームライン毎に)抑える フィードバックについて述べる。このフィード バックでは補正電磁石を用いて作られるローカル バンプ(local bump)を利用する。図12に3つの 補正電磁石(FVS)を用いて作ったローカルバン プの例を示す。図からわかるように1つの偏向電 磁石(BO4)を中心に垂直方向の軌道の山ができ ている。ただし、その他の場所には何の変化も起 こさないようになっている。ビームライン(この 場合BL-4)で測定された光軸の位置の変化と逆 位相のローカルバンプを発生させることでビーム 変動を抑えることができる。

このフィードバックはアナログ的にもデジタル 的にも扱うことができるが、PFリングでは図13に 示すようにアナログ回路によってシステムが構成 されている。その意味でこのシステムは"アナロ グ"・フィードバック(AFB:analog feedback)・ システムとも呼ばれている。アナログの場合デジ タルと比較してノイズに弱く取扱いが難しいが, より速い変動成分を抑えることができる。まず, ビームラインの放射光ビーム位置モニターで光軸 の位置変化を感知し,その信号をサーボ・コント ローラ(servo controller)に渡す。サーボ・コン トローラはシステムの周波数特性や信号のgain を調整して,フィードバックの安定化及び最適化 を行う。その後,信号はローカルバンプを作るた めの電流比を生み出す回路(bump ratio control ler)を経て,3つの補正電磁石電源に送られる。 途中,サムアンプ(sum amplifier)を通じてDFB システムのDAC信号との和が取られるので,DF Bとの共存ができるようになっている。

図14にBL-12で行われたシステムの試行実験 結果を示す。上図はBL-12のWMからの信号をF FTアナライザーで出力したものであり、下図は チャート・レコーダーで記録したものである。図 からわかるように、AFBによってゆっくりとした ビーム変動の他に速い成分もよく抑えられてい る。



Fig.12 Example of a local bump.

-12-



Analog Feedback SYSTEM

Fig.13 Feedback system using a local bump.

-13-

123



Fig.14 Photon beam motion without and with the analog feedback system. The upper histograms were obtained with an FFT analyzer and the lower traces were recorded with a chart recorder.

### 7. まとめ

軌道フィードバック・システムによってビーム 変動は低エミッタンス化直後と比較して水平方向 で約1/5, 垂直方向で約1/10(変動パターン方 式)に減少した。今後は軌道フィードバック・シ ステムをさらに発展させるとともに、ローカルバ ンプを用いたフィードバック・システムを実用化 させることが課題である。それと同時にビーム変 動の原因を直接取り除いてしまうことも考えてい きたい。既に日較差変動の原因である建物の熱変 形を抑えるための屋根の断熱工事が完了し、その 効果を評価する段階に入っている。これについて は後に詳しい報告があるのでここでは省略させて

#### いただくことにした。

最後に,光軸安定化の責任者である桂共太郎助 教授,フィードバック・システム全般について共 同開発を行ってきた神谷幸秀助教授,芳賀開一助 手に謝意を表する。また,放射光ビーム位置モニ ター開発の中心となっている三橋利行助手, フィードバックに必要なリングのパラメータを提 供していただいた加藤政博助手に感謝する次第で ある。

-14-

### 文献

- Y.Kamiya, M.Katoh, I.Honjo, A Araki, and M.Kihara, Proc. of the IEEE Particle Accel. Conf., 455 (1987).
- 2) T.Katsura, Y.Kamiya, K.Haga, and T.Mitsuhashi,
   Proc. of the IEEE Particle Accel. Conf., 538 (1987).
- 3) T.Katsura, Y.Kamiya,K.Haga, and T.Mitsuhashi,
  N Nakamura, M.Katoh, and I.Abe, Rev. Sci.
  Instrum., 60, 1507 (1989).
- 4) K.Huke, Rev. Sci. Instrum., 60, 1382 (1989).
- 5) T.Katsura, Y.Kamiya, T.Mitsuhashi, N.Nakamura, K.Haga, and A.Iida, Rev.Sci.Instrum., **60**, 1957 (1989).
- 6) N.Nakamura, A.Araki, K.Haga, Y.Kamiya, T.Katsura, and Y.Inoue, Submitted to the 14th Int. Conf. on High Energy Accel., 1989 Tsukuba, Japan.
- 7) K.Huke, Jpn. J.Appl. Phys., 26, 285 (1987).
- 8) R.O. Hettel, IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-30, 2228 (1983).
- 9) L.H.Yu. R.J.Nawrocky, and J.Galayda, IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-32, 3394 (1985).
- 10) W.Brefeld, Nucl. Instrum. Methods, A261, 22 (1987).
- T.Katsura, H.Nakagawa, and S.Shibata, IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-30, 2353 (1983).
- 12) T.Katsura and S.Shibata, KEK-Report 79-27 (1979).
- N.Nakamura, K.Haga, T.Katsura, and Y. Kamiya, KEK-Internal 88-14 (1988).
- 14) 桂 共太郎, 放射光を利用したビーム・モニター OHO'86
- 15) T.Mitsuhashi, K.Haga, and T.Katsura, Proc. of the IEEE Particle Accel. Conf., 576 (1987).
- 16) 佐々木 聡, 三橋利行, 放射光学会誌第2巻第4号.
- 17) K.Haga, Y.Kamiya, M.Katoh, T.Katsura, T.

Mitsuhashi, and N.Nakamura, Submitted to the 14th Int. Conf. on High Energy Accel., 1989, Tsukuba, Japan

- 18) T.Katsura, Y.Kamiya,K.Haga,T.Mitsuhashi, and R.O Hettel, Proc. of the 13th Int. Conf.on High Energy Accel., Vol.2, 243 (1986).
- 19) R.O.Hettel, Nucl. Instrum. Methods, A266, 155 (1988).
- 20) R.J.Nawrocky, J.W.Bittner, L.Ma, H.M.Rarback, D.P.Siddons, and L.H.Yu, Nucl.Instrum. Methods, A266, 164 (1988).
- 21) W.Brefeld, Rev. Sci. Instrum.,60, 1523 (1989).

きいわーろ

#### エミッタンス(emittance)

リングを周回する1つの荷電粒子を考える(ただしシ ンクロトロン放射の影響を考えない)場合,エミッタン ス  $\varepsilon$  は粒子が位相平面(x, x')上で描く軌跡(楕円)の 面積を  $\pi$ で割ったものである。すなわち,

 $\pi \varepsilon = \iint dx dx'$ 

である。ここで, x, x'は粒子のリング中心からの水平ま たは垂直方向の位置と傾きである。この場合, エミッタ ンスはリングの場所に依存しない不変量になる。しか し, 電子の場合にはシンクロトロン放射を行うので個々 の電子のエミッタンスは時間的にランダムな変化をす る。それでも電子ビームという集団を考えた場合には, エミッタンスは平衡状態においてある決まった幅を持つ ガウス分布になる。通常, そのガウス分布の1 σをもっ てビームのエミッタンスと呼んでいる。エミッタンスと ビームサイズとは密接な関係があり, ビームサイズを 絞って放射光の輝度を高めるためにはビームのエミッタ ンスを下げる必要がある。

#### 分散関数(dispersion function)

簡単のために電子が偏向電磁石がつくるような一様磁 場中を通る場合を考える。このとき電子は円運動を行う が、電子の運動量が大きいとその半径あるいは周長は長 くなる。偏向電磁石の他に四極電磁石が入った実際のリ ングでは軌道はやや複雑になるが、やはり運動量の大き なビームはより外側を回り軌道長は長くなる。リング上 のある点sにおいてΔpだけ運動量のずれた電子の水平 方向の位置変化Δxは次のように表される。

 $\Delta \mathbf{x}(\mathbf{s}) = \eta \ (\mathbf{s}) \cdot \ (\Delta \mathbf{p}/\mathbf{p})$ 

このときの比例係数 η (s)が分散関数である。建物の 熱変形でリングの周長が伸びると、電子はリング中心よ り内側を回ることになり運動量が小さくなったことと同 等の結果を生む。

#### RF周波数

高周波加速空洞(RF cavity)ではビームの進行方向に 高周波電場をかけてシンクロトロン放射で失われるエネ ルギーを補給している。その高周波電場の周波数をRF 周波数と呼んでいる。RF周波数 $f_{RF}$ は電子がリングを1 周する周波数 f。(周回周波数)と次のような関係に なっている。

 $f_{RF} = h \cdot f_0$ 

ここで、hはharmonic numberと呼ばれる整数で、 電子ビームは最大でharmonic numberだけバンチ数を 持つことができる。また、RF周波数の変化は電子の軌 道長Cを変化させ次式が成り立つ。

 $\Delta \mathbf{f}_{RF}/\mathbf{f}_{RF} = -\Delta \mathbf{C}/\mathbf{C}$ 

#### momentum compaction factor

ー般に,電子の運動量(p)が大きいとリング内での電子の軌道長(C)は長くなる。それを式にすると,

 $\Delta C/C = \alpha \cdot (\Delta p/p)$ 

となる。この係数  $\alpha$  をmomentum compaction factor と呼ぶ。momentum compaction factorはリングの分 散関数  $\eta$  (s)と曲率半径  $\rho$  (s)を使って

 $\alpha = \mathbf{\mathscr{G}} (\eta / \rho) \, \mathrm{ds} \cdot (1/\mathrm{C})$ 

と表わすことができる。ここで、  $\phi$ dsはリング一周の 積分を意味する。